

2025年3月期中間期 決算説明会

2024年 11月18日



～TTT-26 超純水技術で未来を創造する～

野村マイクロ・サイエンス株式会社

東京証券取引所 プライム市場：6254

1 2025年3月期中間期 決算概況



売上高： 18,042百万円（前年同期比50.6%減）

水処理装置： 10,396百万円（同64.1%減）

- ・国内で受注した大型水処理装置の売上が寄与
- ・海外各地の大型水処理装置案件が一巡

メンテナンス及び消耗品： 6,327百万円（同2.2%増）

- ・半導体関連企業を中心に受注が前年並みに推移

その他の事業： 1,319百万円（同5.3%減）

- ・半導体関連の配管材料等を中心に受注が前年並みに推移

営業利益： 1,552百万円（前年同期比同72.9%減）

- ・水処理装置案件減収により売上総利益減益
- ・人員増加等に伴う販売費及び一般管理費の増加

経常利益： 59百万円（前年同期比99.0%減）

- ・支払利息 742百万円
- ・為替差損 796百万円

親会社株主に帰属する中間純利益： 28百万円（前年同期比99.3%減）

損益計算書の概要



大型水処理装置の一巡により前年同期比減収
減収要因と共に販管費増及び為替差損、支払利息等により減益

	2024年3月期 (上期)		2025年3月期 (上期)				
	金額 (百万円)	構成比 (%)	期初計画 2024/5/15	金額 (百万円)	構成比 (%)	前年同期比	
						増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	36,555	100.0	23,000	18,042	100.0	△18,512	△50.6
売上総利益	7,909	21.6	5,150	4,322	24.0	△3,587	△45.4
営業利益	5,722	15.7	2,450	1,552	8.6	△4,169	△72.9
経常利益	6,242	17.1	2,350	59	0.3	△6,182	△99.0
親会社株主に帰属する 中間純利益	4,061	11.1	1,700	28	0.2	△4,033	△99.3

貸借対照表の概要



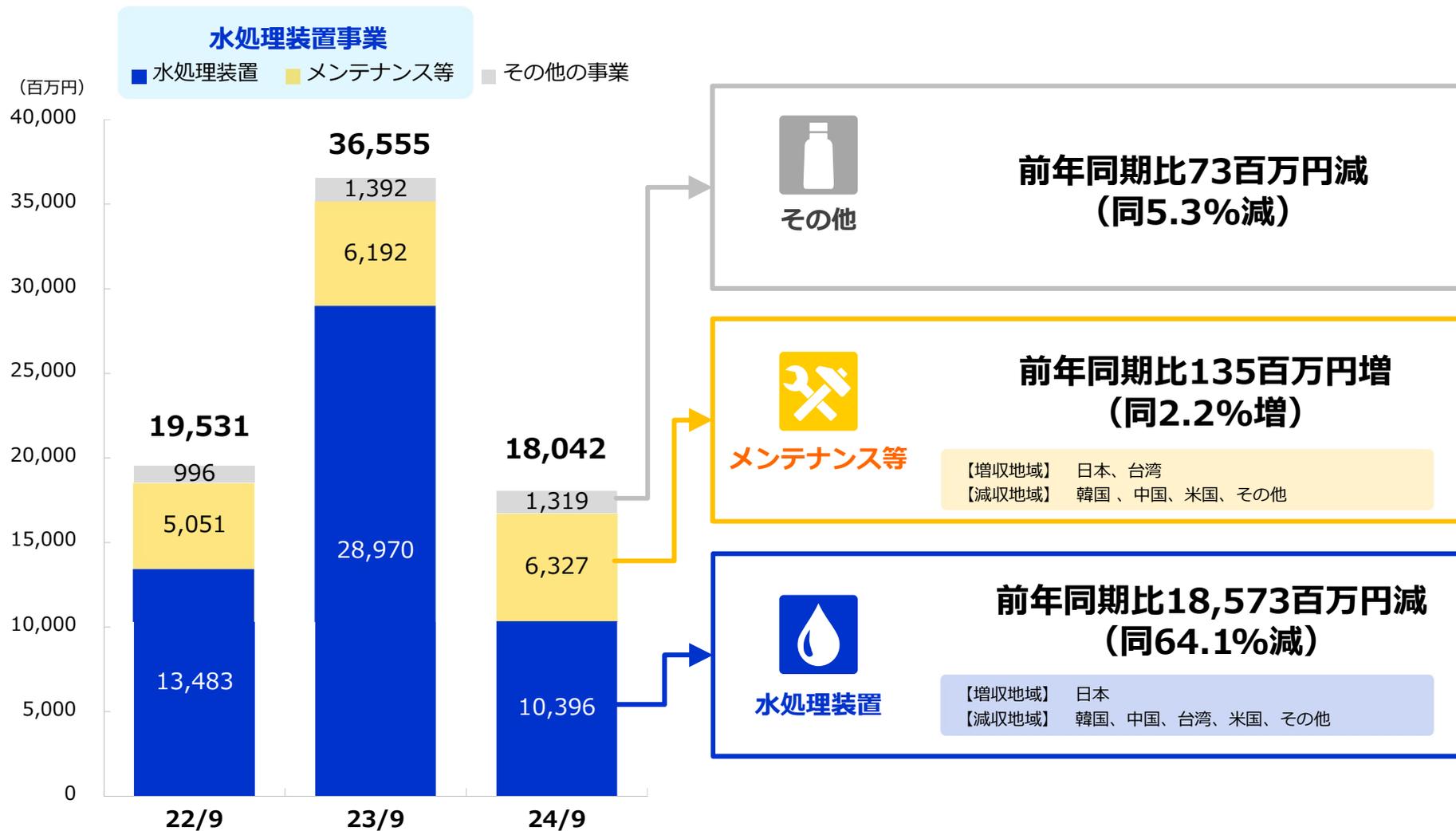
大型案件対応により仕掛品、短期借入金が増加

	2024年3月期 (期末)		2025年3月期 (上期)			
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	主な増減要因
流動資産	65,504	92.8	80,260	90.8	14,755	受取手形、売掛金及び契約資産 仕掛品 $\Delta 7,247$ $+19,365$
固定資産	5,098	7.2	8,154	9.2	3,056	
資産合計	70,602	100.0	88,415	100.0	17,812	
流動負債	41,280	58.5	59,595	67.4	18,315	短期借入金 $+14,648$
固定負債	397	0.6	1,129	1.3	731	
負債合計	41,678	59.0	60,724	68.7	19,046	
純資産合計	28,924	41.0	27,690	31.3	$\Delta 1,233$	利益剰余金 $\Delta 1,753$
負債・純資産合計	70,602	100.0	88,415	100.0	17,812	

事業別売上高



日本国内では大型装置案件の増加により増収も、日本国内以外は装置売上が一巡し減収
メンテナンスは概ね堅調に推移し増収

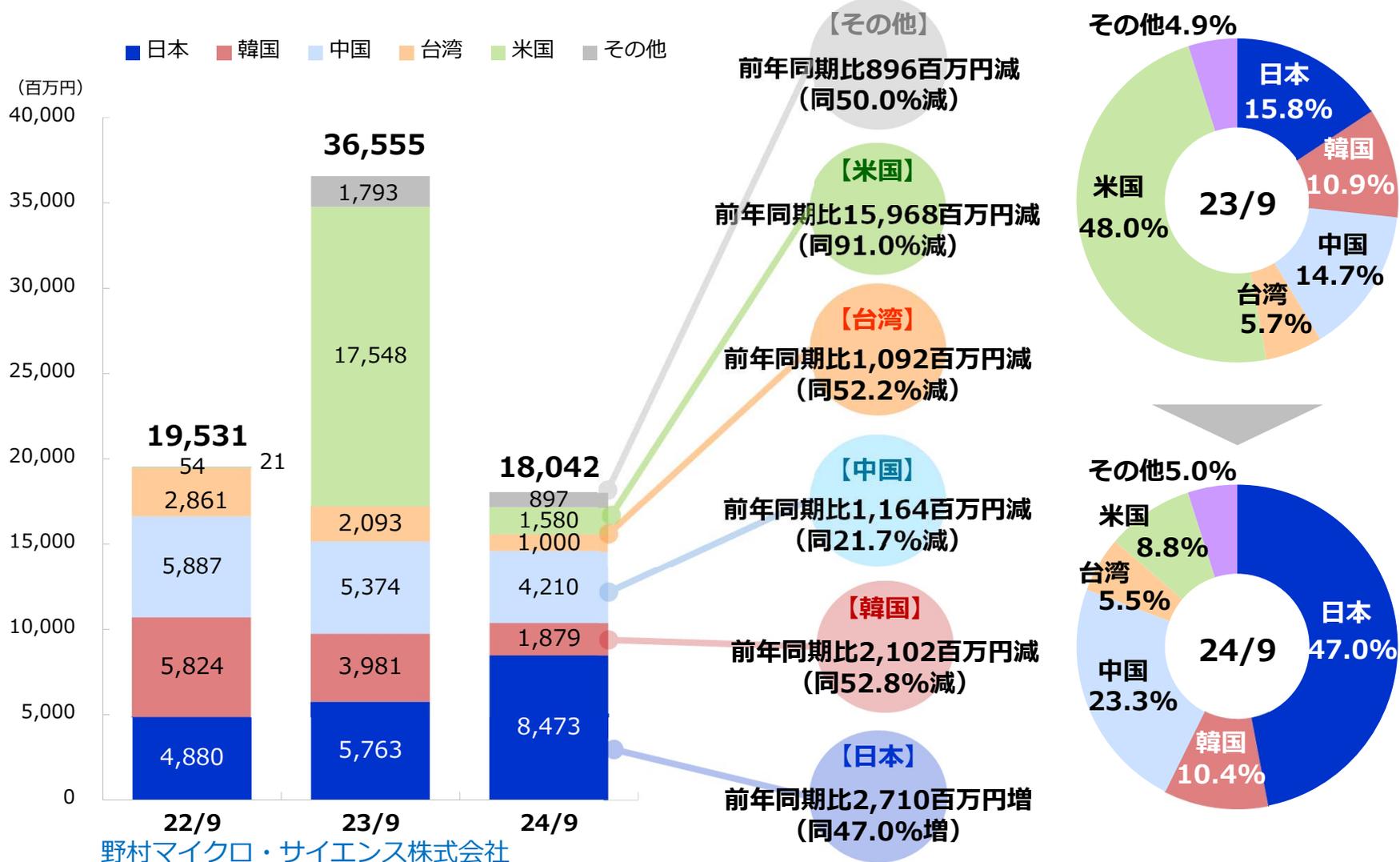


地域別売上高・売上構成

※顧客の所在地別にて集計



日本国内案件の増加により同地域のシェアが拡大
 上期は主要顧客の投資の谷間となり、米国・韓国は大幅に減収



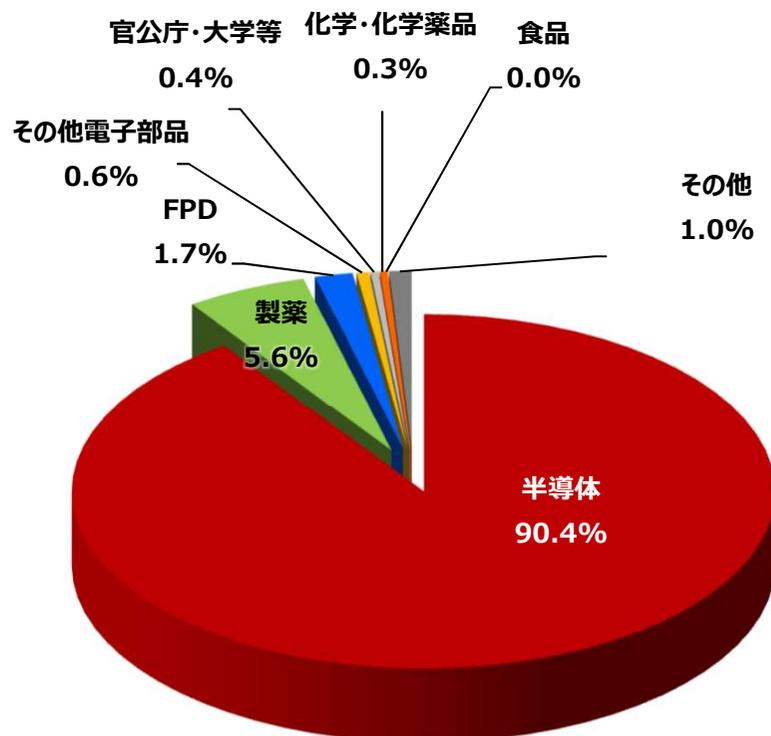
業種別売上構成



主力半導体傾向は不変 製薬も堅調に推移

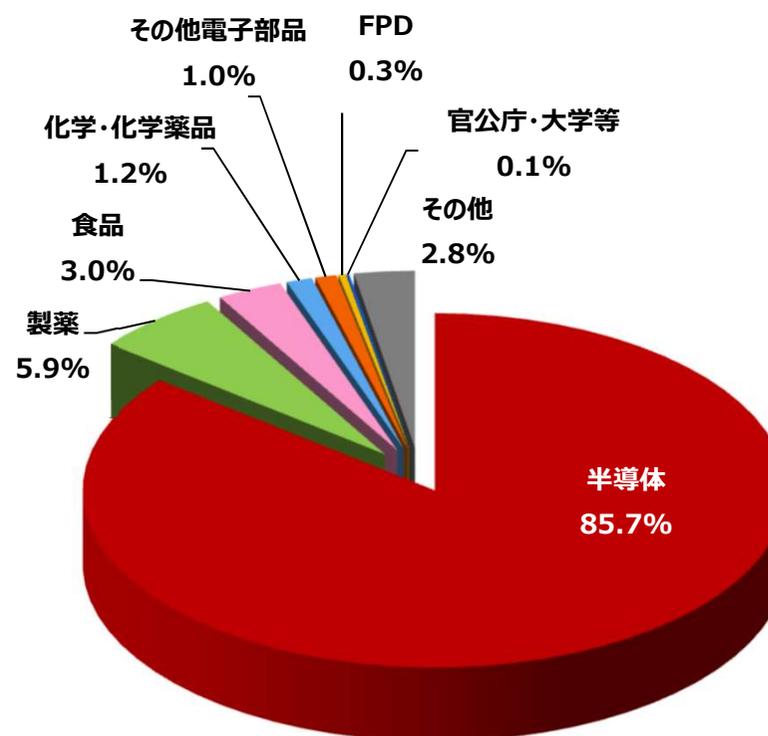
売上相手先別 (メンテナンス・消耗品を含む)

2024年3月期 中間期



売上高 365億円

2025年3月期 中間期



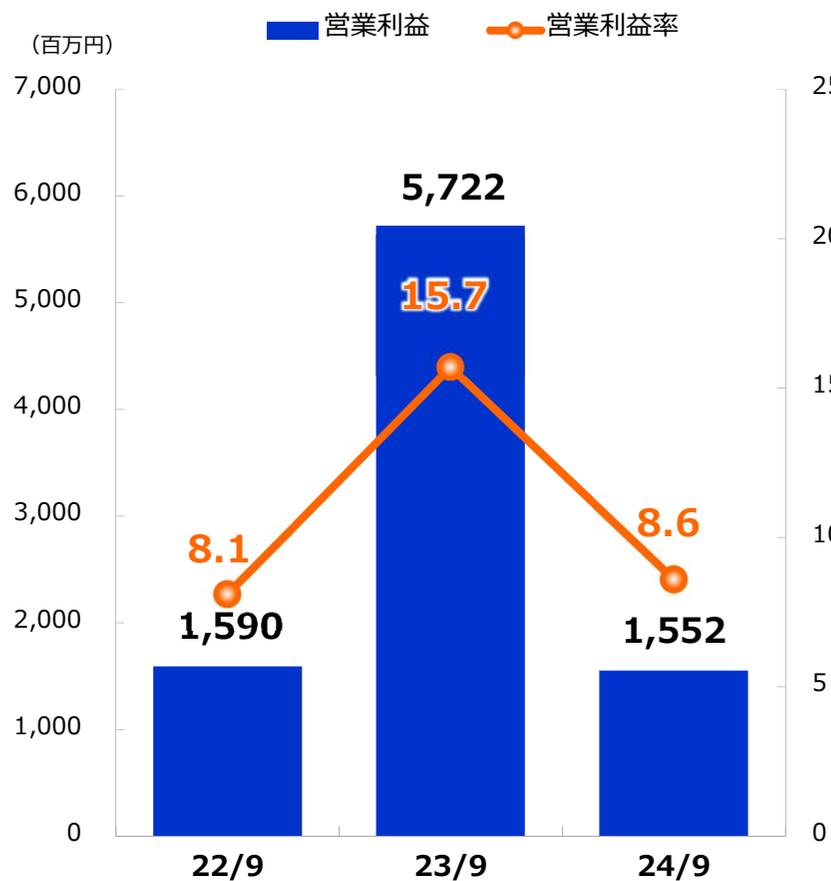
売上高 180億円

営業利益・経常利益

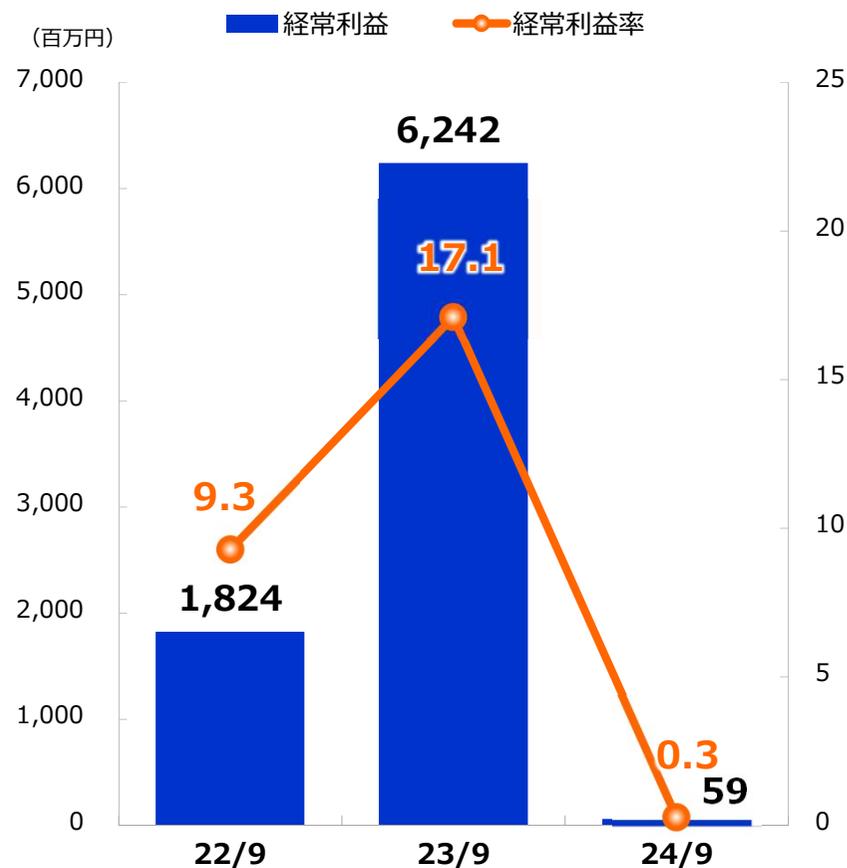


大幅減収により営業利益、経常利益ともに減益

営業利益



経常利益

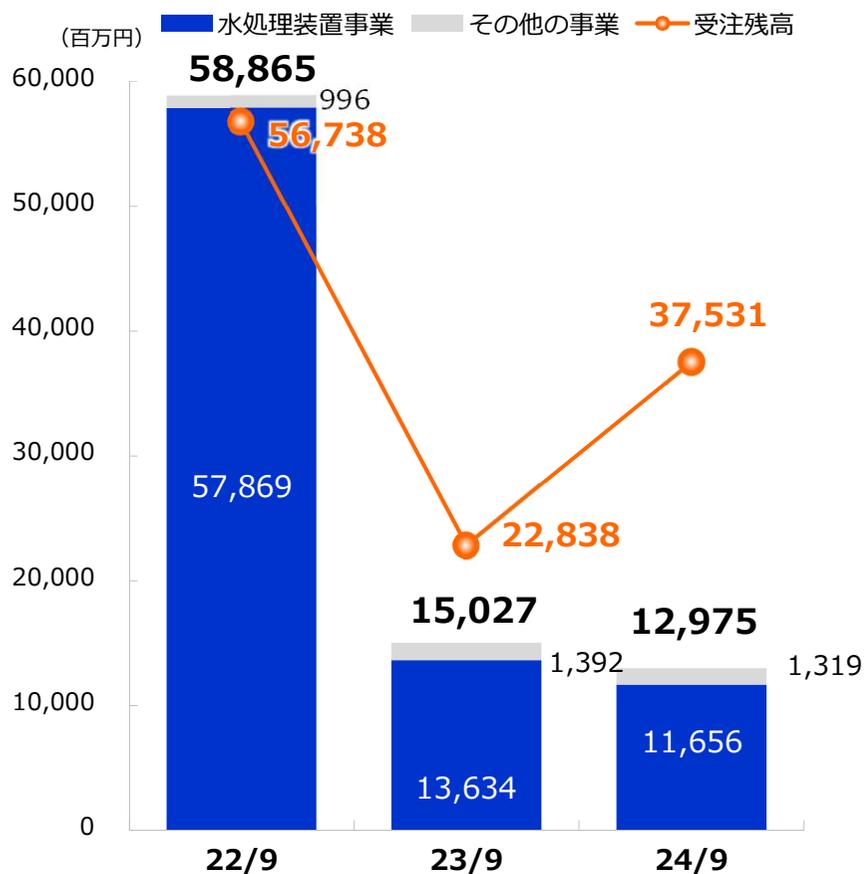


受注高・受注残高

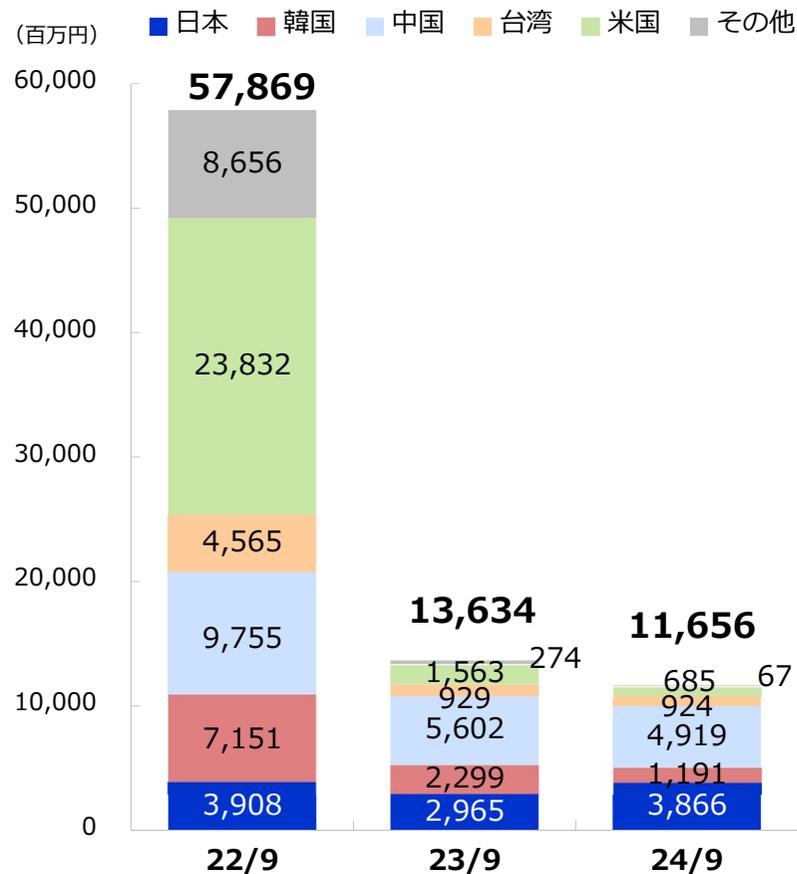


半導体関連の引き合いは堅調も上半期受注は低調

事業別受注高



水処理装置事業の地域別受注高



キャッシュ・フローの概要



仕掛品増加（大型案件対応）による必要資金を短期借入金にて調達

(百万円)

	2024年3月期 (上期)	2025年3月期 (上期)	主な増減要因	
営業キャッシュ・フロー	△3,673	△11,719	売上債権の減少額 たな卸資産の増加額 契約負債の増加額	+5,981 △22,560 +3,323
投資キャッシュ・フロー	574	△3,856	有形固定資産の取得による支出	△3,255
フリーキャッシュ・フロー	△3,099	△15,575		
財務キャッシュ・フロー	10,470	12,843	短期借入れによる収入	+14,659
現金及び現金同等物の 増減額	8,037	△1,006		
現金及び現金同等物の 中間期末残高	21,253	10,853		

2 2025年3月期業績見通し



事業環境

● 世界経済

- ・ 欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞に伴う影響、地政学リスクの高まり等、景気下振れリスクは払拭されておらず不透明な状況が続くと予測

● 半導体市況

- ・ PC、民生用機器等は低迷も、生成AI向けサーバーの需要は拡大
- ・ データセンター増によるメモリー投資は回復基調
- ・ 生成AIやデジタルトランスフォーメーション（DX）の進化を受けて世界で半導体メーカー各社は設備投資意欲旺盛も、各マーケットのブレイクアウト時期を慎重に様子見し設備投資実施
- ・ 米国の対中規制強化は継続して動向注視が必要
- ・ 経済安全保障の観点から各地域（新興国：東南アジア、インド含む）にて自国での半導体製造拠点整備を強化

● 製薬市況

- ・ 新薬、バイオ製剤等を中心とした内需製薬関連投資が継続
- ・ 日本政府の医薬品関連サプライチェーン強化に向けた投資促進事業費補助金により加速

売上高：88,000百万円（前期比20.5%増）

水処理装置：69,990百万円（前期比21.5%増）

- ・下期に米国大型案件受注見込
- ・日本、米国等で大型水処理装置案件の売上が寄与

メンテナンス及び消耗品：15,473百万円（同19.4%増）

- ・半導体、製薬を中心に各地域で受注が堅調に推移

その他の事業：2,535百万円（同3.0%増）

- ・配管材料を中心に引き続き高水準で推移する見通し

水処理装置事業の大幅増収により営業利益、経常利益で増益

営業利益：12,000百万円（前期比12.7%増）

経常利益：11,800百万円（同9.1%増）

親会社株主に帰属する当期純利益：8,650百万円（同8.4%増）

2025年3月期業績見通し



受注動向等勘案し、通期業績見通しは期初予想を据え置き

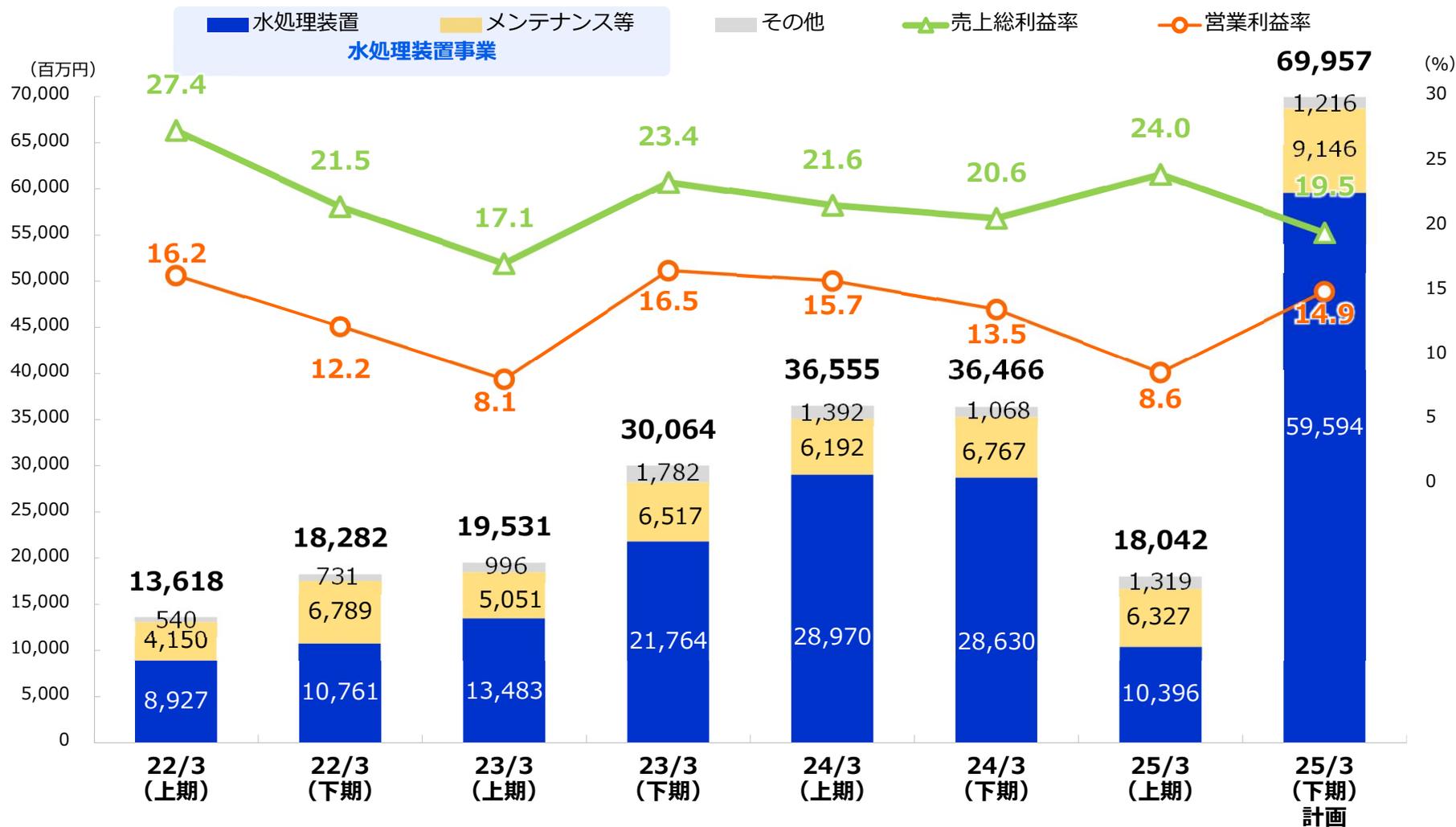
	2024年3月期			2025年3月期				
	上期 (実績)	下期 (実績)	通期 (百万円)	上期 (実績)	下期 (計画)	通期 (計画) (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	36,555	36,466	73,021	18,042	69,957	88,000	+14,978	+20.5
売上総利益	7,909	7,498	15,407	4,322	13,642	17,964	+2,557	+16.6
営業利益	5,722	4,925	10,647	1,552	10,447	12,000	+1,352	+12.7
経常利益	6,242	4,577	10,819	59	11,740	11,800	+980	+9.1
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,061	3,916	7,978	28	8,621	8,650	+671	+8.4
1株当たり当期純利益	108.87円 (*435.51円)	–	213.47円 (*853.89円)	0.74円	229.03円	229.77円	+16.30円	+7.6
1株当たり配当金	15.00円 (*60.00円)	47.50円 (*190.00円)	62.50円 (*250.00円)	20.00円	50.00円	70.00円	+7.50円	–

* 分割前数値を参考として併記

業績推移（半期毎）売上高 利益率



期初計画通り下期偏重の見通し～大型水処理装置の売上が寄与

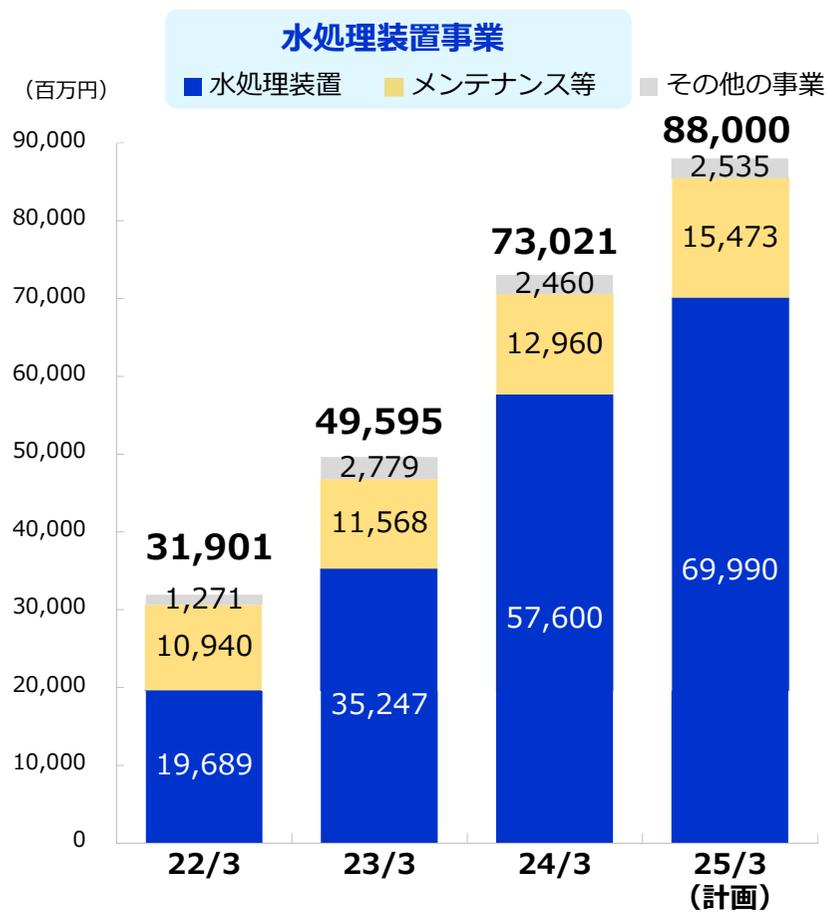


事業別・地域別売上高

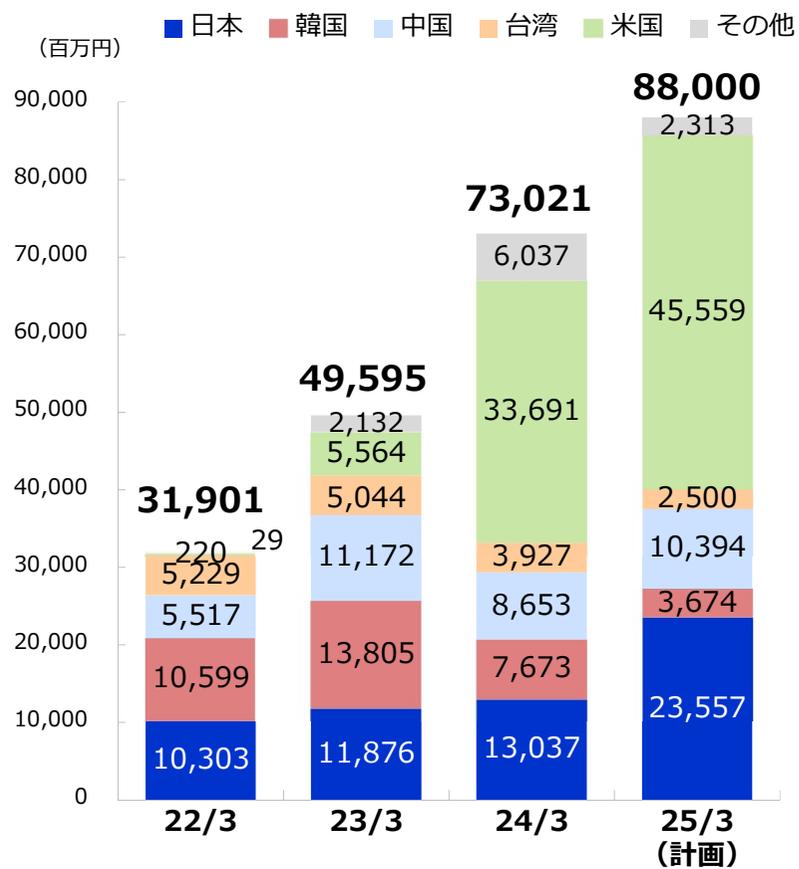


日本、米国等の大型水処理装置の売上が寄与
装置納入増加に伴いメンテナンスは増収基調

事業別売上高



地域別売上高

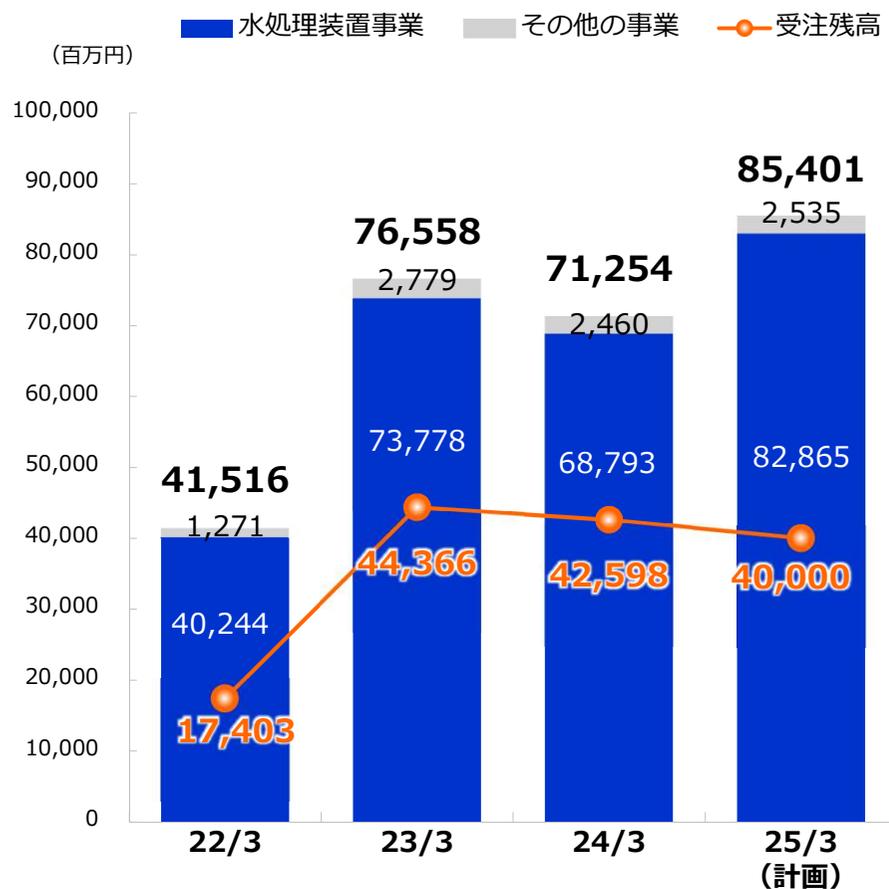


受注高・受注残高

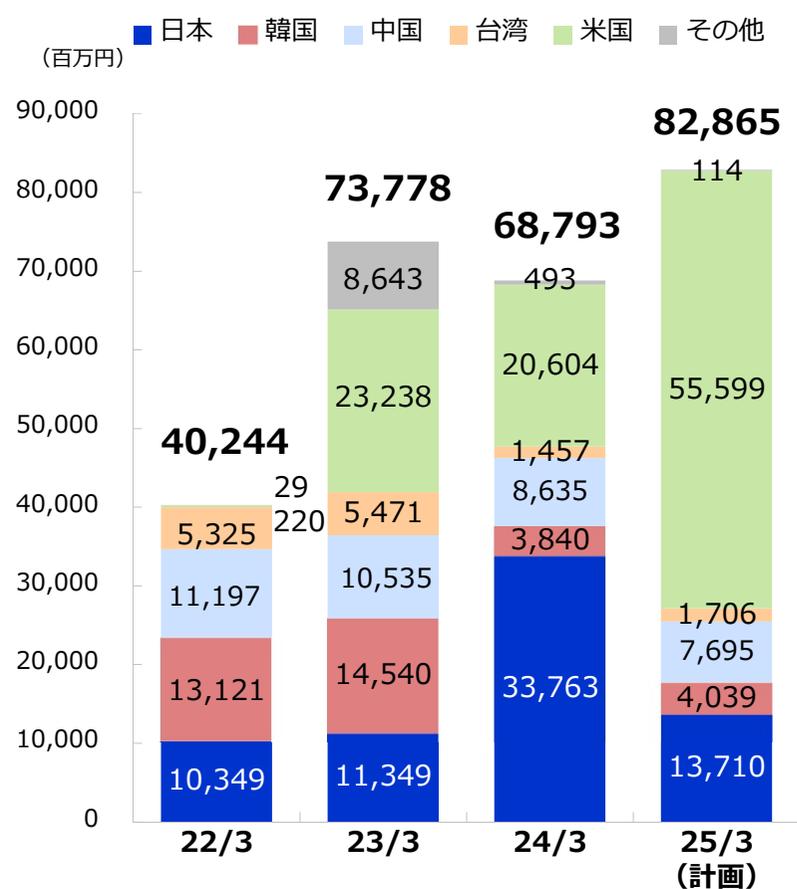


引き合いは引き続き堅調 地域格差はあるも前年を上回る受注高を予想

事業別受注高



水処理装置事業の地域別受注高

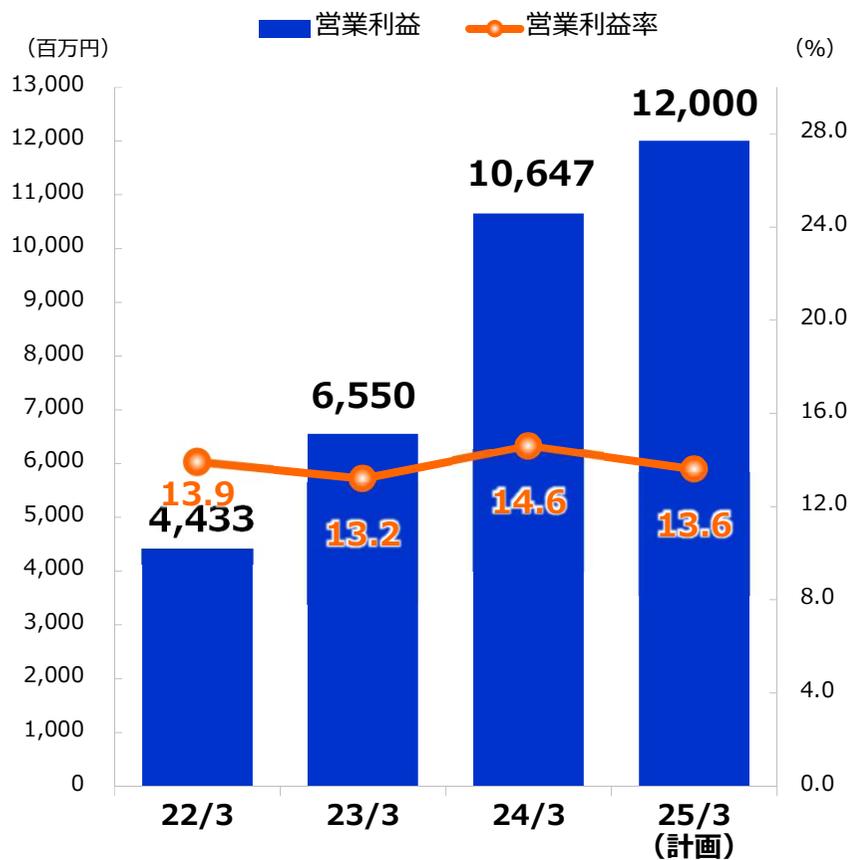


営業利益・経常利益

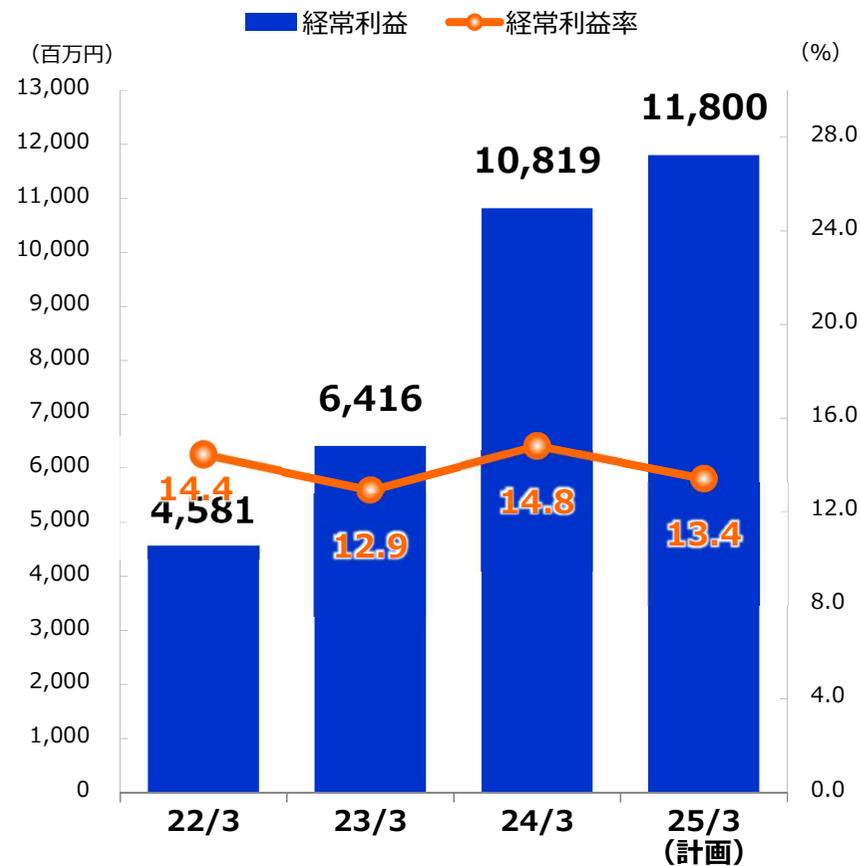


水処理装置の増収及び販管費の増加により利益率低下も増益を予想

営業利益



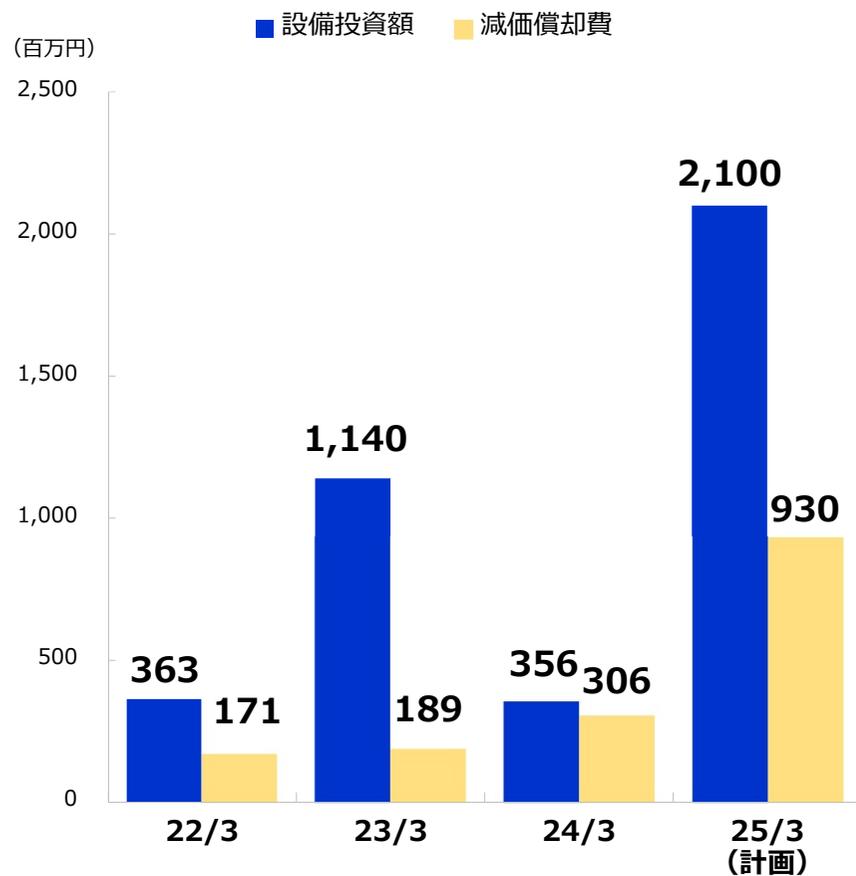
経常利益



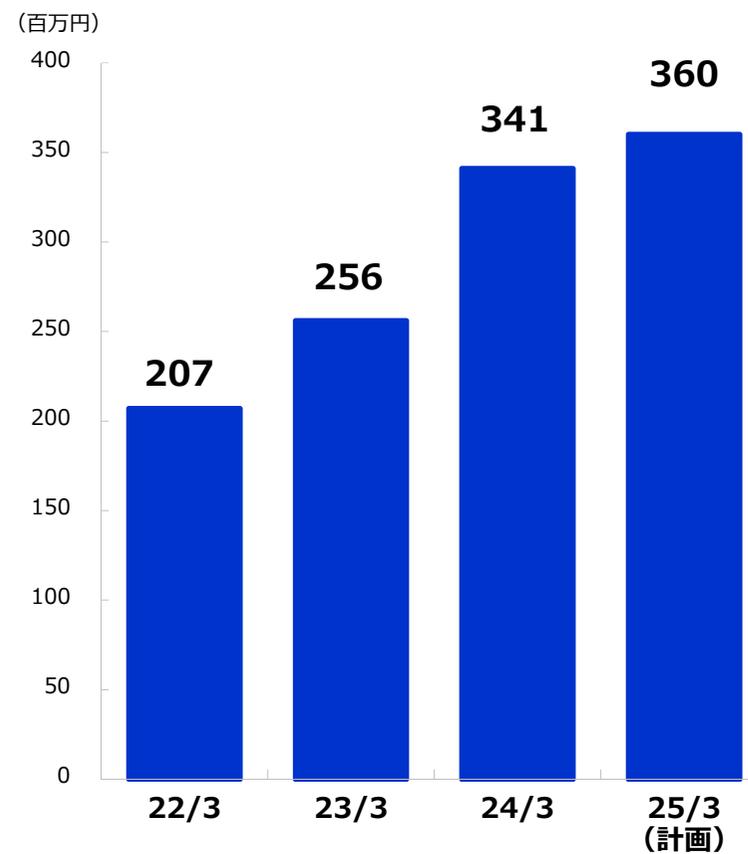
BOOM契約受注により設備投資増加

(*Build Own Operate and Maintenance 弊社がユーザーに超純水装置を提供し、ユーザーが使用した超純水の使用料を支払う契約)

設備投資・減価償却費



研究開発費



3 中期経営計画 概要と進捗



TTT-26

Together Toward Transformation-26

Creating the Future through Ultra-Pure Water Technology

～超純水技術で未来を創造する～

経営ビジョン

- アジアを中心とした半導体・製薬工場向け超純水装置の卓越した会社を目指す
- 高度な技術とサービスを顧客に提供し、ベストパートナーとして共に**経済的価値**と同時に**社会的価値**を創造するサステナビリティ経営を実行する会社を目指す

経営目標

	2027年3月期(中期目標)	2031年3月期(長期目標)
売上高	1,010億円	1,200億円
営業利益	146億円	192億円
営業利益率	14.5%	16.0%
自己資本利益率 (ROE)	25%以上	30%以上
投下資本利益率 (ROIC) *	22%以上	25%以上

*ROIC = 税引営業利益 ÷ (有利子負債 + 株主資本)

企業価値の拡大	取組み	進捗状況
① 営業戦略 収益性拡大	<ul style="list-style-type: none"> 既存取引先との関係強化及び新規顧客開拓 事業安定化に向けた企業基盤構築 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体生産拠点の世界各地への分散に対応し、シンガポール現地法人設立を決定、東南アジア・インド等への拡販を目指す さらなる顧客開拓に向け国内外拠点展開を検討
② エンジニアリングプロセスの改革	<ul style="list-style-type: none"> 効率化、ユニット化、スキッド化推進 人材、デジタル技術等無形資産への投資 	<ul style="list-style-type: none"> パートナー企業でのユニット化、スキッド化製作を一層拡大 地域に応じたエンジニアリング会社との戦略的提携 設計業務等に関してAI技術の導入を検討
③ 研究開発 SMART UP3の加速	<ul style="list-style-type: none"> コアコンピタンスである分析技術の強化 環境負荷低減装置の開発 「その先の超純水」の研究開発促進 	<ul style="list-style-type: none"> シングルナノ分析技術確立に向けた投資～新棟建設を計画 大学との共同研究を推進し、プロセスLineへ機能水導入 最先端半導体向け超純水中不純物のさらなる低減
④ 人的資本強化	<ul style="list-style-type: none"> エンジニアを中心とした技術力向上 社員エンゲージメント、経営参画意識向上 	<ul style="list-style-type: none"> エンジニア早期育成のための社内研修制度等の強化（シニア人材による技術継承） エンゲージメントサーベイ結果に基づいた改善活動及び社員向けストックオプションの実施 有資格者のスカウティング（中途採用の強化）

重点施策①：営業戦略 収益性拡大



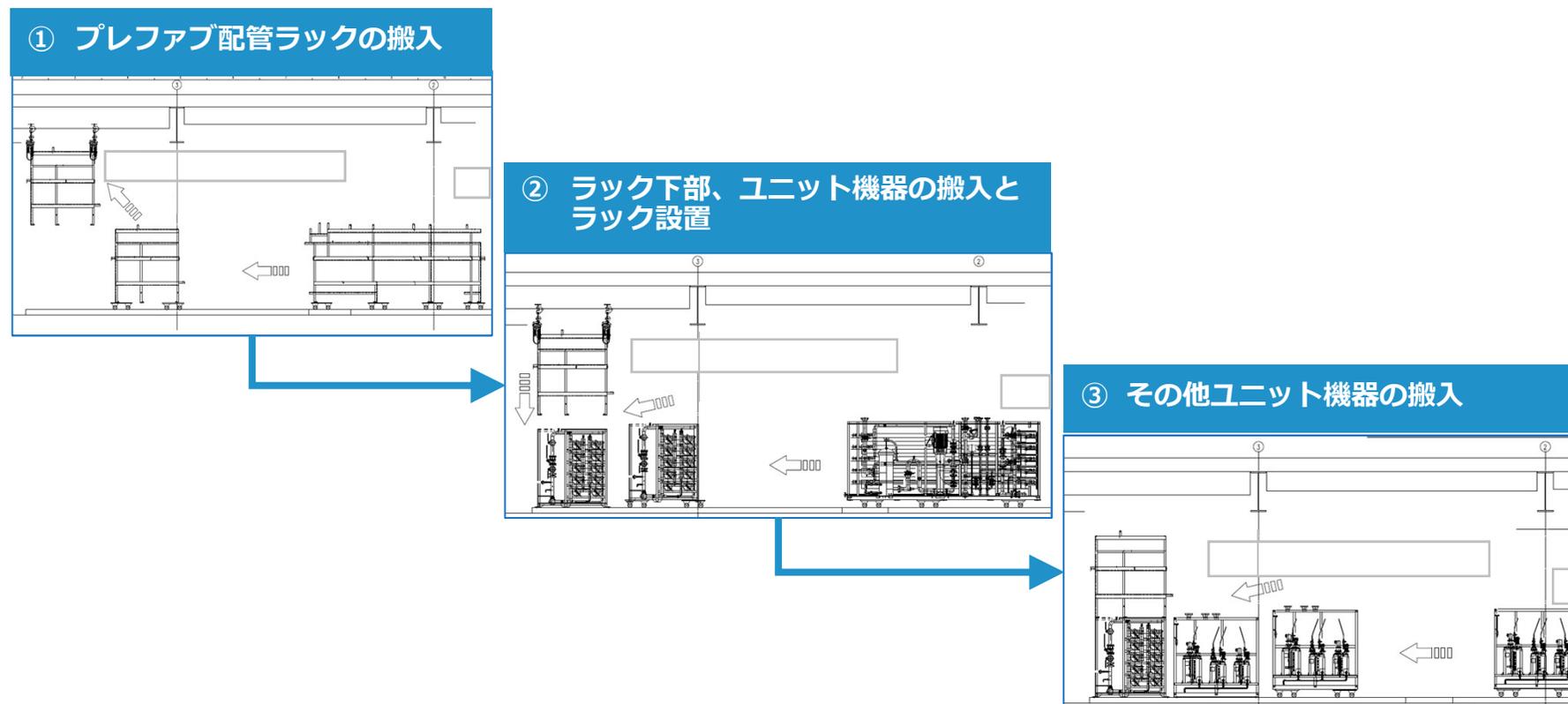
取組み	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 既存取引先との関係強及び新規顧客開拓 事業安定化に向けた企業基盤構築 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体生産拠点の世界各地への分散に対応し、シンガポール現地法人設立を決定、東南アジア・インド等への拡販を目指す さらなる顧客開拓に向け国内外拠点展開を検討



重点施策②：エンジニアリングプロセスの改革

取組み	進捗状況
<ul style="list-style-type: none">効率化、ユニット化、スキッド化推進人材、デジタル技術等無形資産への投資	<ul style="list-style-type: none">パートナー企業でのユニット化、スキッド化製作を一層拡大地域に応じたエンジニアリング会社との戦略的提携設計業務等に関してAI技術の導入を検討

<プレファブ施工（ユニット化、スキッド化）のイメージ図>



重点施策③：研究開発 SMART UP3の加速



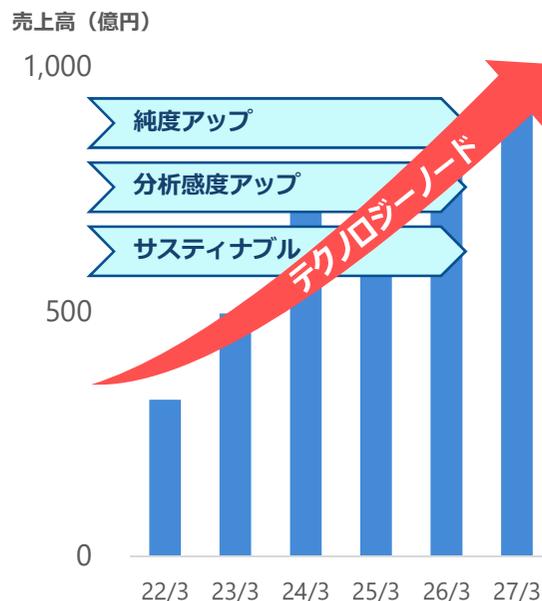
取組み	進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> コアコンピタンスである分析技術の強化 環境負荷低減装置の開発 「その先の超純水」の研究開発促進 	<ul style="list-style-type: none"> シングルナノ分析技術等の確立に向けた投資～新棟建設を計画 大学との共同研究を推進し、プロセスLineへ機能水導入 最先端半導体向け超純水中不純物のさらなる低減

SMART UP 3

◆SMART UP3の加速

- 純度アップ
 - ・装置素材の超高純度化
- 分析感度アップ
 - ・ppqレベルの開発に注力
- 環境貢献アップ
 - ・環境負荷低減
 - ・省電力化
 - ・水使用量削減

◆その先の超純水へ
⇒**SMART UP3+α**



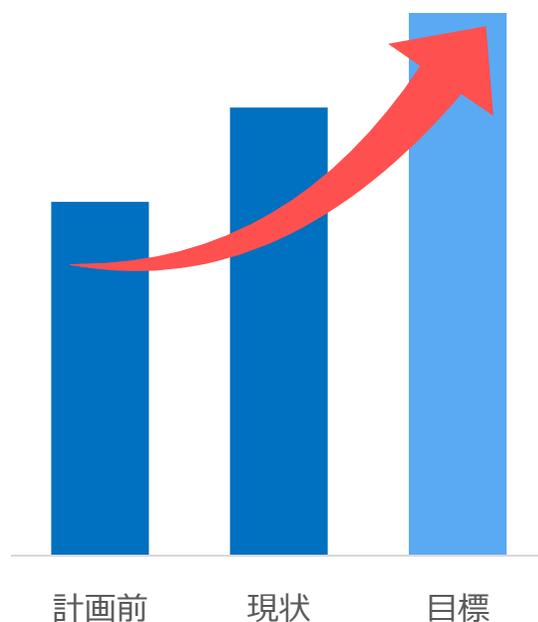
<新棟イメージ>



重点施策④：人的資本強化

取組み	進捗状況
<ul style="list-style-type: none">エンジニアを中心とした技術力向上社員エンゲージメント、経営参画意識向上	<ul style="list-style-type: none">エンジニア早期育成のための社内研修制度等の強化（シニア人材による技術継承）エンゲージメントサーベイ結果に基づいた改善活動及び社員向けストックオプションの実施有資格者のスカウティング（中途採用の強化）

エンジニア育成による技術系有資格者推移



◆ エンゲージメント向上について

- 社内エンゲージメントサーベイ実施
- 人事評価制度における加点方式の推進
- 心理的安全性を高める職場作り推進
- 福利厚生制度の改善・充実 等



企業価値の拡大	取組み	進捗状況
① 営業戦略 収益性拡大	<ul style="list-style-type: none"> 既存取引先との関係強化及び新規顧客開拓 事業安定化に向けた企業基盤構築 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体生産拠点の世界各地への分散に対応し、シンガポール現地法人設立を決定、東南アジア・インド等への拡販を目指す さらなる顧客開拓に向け国内外拠点展開を検討
② エンジニアリングプロセスの改革	<ul style="list-style-type: none"> 効率化、ユニット化、スキッド化推進 人材、デジタル技術等無形資産への投資 	<ul style="list-style-type: none"> パートナー企業でのユニット化、スキッド化製作を一層拡大 地域に応じたエンジニアリング会社との戦略的提携 設計業務等に関してAI技術の導入を検討
③ 研究開発 SMART UP3の加速	<ul style="list-style-type: none"> コアコンピタンスである分析技術の強化 環境負荷低減装置の開発 「その先の超純水」の研究開発促進 	<ul style="list-style-type: none"> シングルナノ分析技術確立に向けた投資～新棟建設を計画 大学との共同研究を推進し、プロセスLineへ機能水導入 最先端半導体向け超純水中不純物のさらなる低減
④ 人的資本強化	<ul style="list-style-type: none"> エンジニアを中心とした技術力向上 社員エンゲージメント、経営参画意識向上 	<ul style="list-style-type: none"> エンジニア早期育成のための社内研修制度等の強化（シニア人材による教育資料の構築） エンゲージメントサーベイ結果に基づいた改善活動及び社員向けストックオプションの実施 有資格者のスカウティング（中途採用の強化）

- 本資料には野村マイクロ・サイエンス株式会社(以下、弊社)の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述及び資料が記載されております。
- これらの将来的予測に関する記述及び資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。
- また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

野村マイクロ・サイエンス株式会社

総務部

TEL 046-228-5195

URL <https://www.nomura-nms.co.jp>